

變更台南科學工業園區特定區計畫（科學園區部分）
（部分環保設施用地為事業專用區）書

擬定機關：台南縣政府
中華民國95年3月

壹、緣起

光電產業為我國近年來高速成長的產業，是繼資訊與半導體產業之後，另一具發展潛力的高科技產業，發展出之新興產品，產業關聯性高，且對供應能源需求不大，能源依存度低。為了積極發展平面顯示器科技及產值，以期達成2006年兩兆雙星願望，政府正積極推動「平面顯示器國家型科技計畫」。

根據光電科技工業協進會（PIDA）統計，台灣光電產業總產值隨著全球光電市場的成長而增加，2004年台灣光電產業總產值達新台幣9,214億元，比2003年6755億元成長36%；而預估台灣光電產業的產值2005年將突破一兆大關。與全球光電市場趨勢一致，台灣光電元件和光電顯示器成長性較高，成長率分別為39%與62%。尤其台灣TFT-LCD產業近年大幅投資，成為台灣光電產業成長的火車頭，使得台灣光電產業的全球佔有率逐年提昇。

目前南科園區內的光電相關廠商，包括奇美電子、翰宇彩晶等旗艦型光電廠商積極投入大筆資金興建5代、5.5代TFT-LCD面板廠，其中奇美電子於93年與台南縣政府簽訂「南科液晶電視及產業支援工業區」合作計畫，規劃旗艦型園區，以產業聚落化，來提高液晶電視產業之競爭力；而於今年度奇美電子公司將進行3大投資案擴建計畫，包括再投資新台幣200億元，將現有5.5代面板廠月投片量由原訂的12萬片提升到18萬片，及投資350億元再擴建1座5代廠，同時宣佈跨入7.5代面板廠投資案等，顯示南科目前光電產業聚落效應已逐漸成型。

鑑此，基於目前面板產業已逐漸朝向大規格生產型態，連帶影響廠房規模得隨之擴展，故現況位於南科園區內「專9」事業專用區已不敷廠房興建使用，亟需變更部分環保設施用地「環2」為事業專用區，使廠商能持續研發高階及新技術產品，以強化產業競爭力，促進國家高科技產業發展，故案經行政院國家科學委員會於94年7月8日臺會協字第0940043796號函認定，本案符合都市計畫法第27條第1項第3款規定，係為經濟發展需求（詳附件一），並經內政部於94年8月15日內授營都字第0940085300號函同意辦理都市計畫個案變更在案（詳附件二）。

貳、法令依據

- 一、都市計畫法第27條第一項第三款。
- 二、內政部94年8月15日內授營都字第0940085300號函。

參、變更位置、範圍及面積

本案變更基地係位於園區中央位置之環保設施用地（環2）（計畫面積11.60公頃）北側部分範圍，其東側緊臨事業專用區（專9），北側及西側則臨接30公尺計畫道路，變更部分之面積約3.55公頃。

圖一為變更位置示意圖。

肆、變更理由

- 一、因應高科技產業不斷研發高階技術之發展趨勢，廠房規模隨之擴增，因此廠商設廠用地需求殷切。
- 二、擬調整變更為事業專用區之環保設施用地部分，係提供興建污水處理廠使用，現況尚未闢建，故並未影響目前園區內污水處理功能。另事業專用區內亦容許設置環境保護設施，故在不影響廠房整體規劃及運作下，亦可彈性設置污水處理設施，可對園區內污水處理能力之影響降至最低。

伍、變更計畫內容

本案變更計畫內容主要係變更部分環保設施用地為事業專用區，面積為3.55公頃。

表二為變更內容明細表、表三為變更前後土地使用面積增減表。

圖二為變更計畫示意圖。

表二 變更內容明細表

編號	位置	變更內容		變更理由	備註
		原計畫	新計畫		
一	「環 2」環 保設施 用地北 側	環保設施用 地 (3.55公頃)	事業專用區 (3.55公頃)	<ol style="list-style-type: none">1.因應高科技產業不斷研發高階技術之發展趨勢，廠房規模隨之擴增，因此廠商設廠用地需求殷切。2.擬調整變更為事業專用區之環保設施用地部分，係提供興建污水處理廠使用，現況尚未闢建，故並未影響目前園區內污水處理功能。另事業專用區內亦容許設置環境保護設施，故在不影響廠房整體規劃及運作下，亦可彈性設置污水處理設施，可對園區內污水處理能力之影響降至最低。	

註：表內面積僅供參考，實際面積應以依據核定圖實地分割測量面積為準。

陸、事業及財務計畫

本次變更用地皆為台南科學工業園區內用地，依據「科學工業園區設置管理條例」園區內用地均已登錄為國有土地，並由南部科學工業園區管理局管理各項土地出租與使用事宜。事業專用區經需地單位承租後，用地整地與建築開發由承租單位辦理及負擔經費。

柒、對南部科學工業園區之影響分析

一、環保設施用地減少對園區之影響分析

依據「台南科學工業園區二期基地細部規劃」案（台南科學工業園區開發籌備處，民國91年6月）中針對園區內所產生的污水量進行推估，推估結果台南園區一、二期基地開發完成後所產生之平均日污水量合計約為165,000CMD，其中一期基地所需處理之污水容量為90,000CMD，且其污水處理廠亦已於「環2」環保設施用地內興建完成；而另外75,000CMD污水處理量則配合二期基地開發時程分兩階段執行，各階段預估處理設計之污水量均為37,500CMD。

由於本案變更位置係位於「環2」環保設施用地北側尚未開發部分，變更為事業專用區後，依現行南科特定區計畫科學園區部分土地管制要點之規定亦得容許環境保護設施使用。因此，該部分變更為事業專用區後將與「專9」事業專用區連結為一完整基地，且由同一廠商承租，在不影響廠房整體規劃及運作下，園區管理局已與廠商達成協議，若需於該土地興建污水處理設施及相關建築物，廠商應出具土地使用同意書同意之（詳附件三），且其污水處理量應達二期基地第一階段預估之37,500CMD污水量；而第二階段之污水處理設施未來則配合廠商進駐時程，於「環3」環保設施用地內再進行規劃設計。因此本案變更後對於科學園區部分之污水處理能力，並不致造成衝擊。

二、對園區交通及環境之影響分析

本案變更後雖造成土地使用項目及強度放寬，惟依據前述，變更範圍內土地已與廠商達成協議，需提供興建污水處理設施且應達到二期基地第一階段預估之污水處理量，並非主要作為事業專用區之開發利用；另本案主要係配合奇美面板產業朝大規格生產型態，為發揮最大經濟效益，廠房規模必須擴充以為因應，惟目前均以自動化生產線為主，故規模擴充並未相對地造成員工數量隨之增加，因此對於鄰近周邊的交通與環境不致造成衝擊。